

Porta Wafer In Ptfе Per Semiconduttori 8 Pollici Resistente Alla Pulizia A Umido E All'incisione Con Hf

Numero articolo: PL-CP82



introduzione

Ottimizza la lavorazione dei semiconduttori con questo porta wafer premium in PTFE da 8 pollici, progettato per applicazioni di pulizia ad alta purezza a umido e incisione con HF. Le nostre cassette in fluoropolimero di grado industriale garantiscono la massima resistenza chimica, una durata superiore e una manipolazione precisa per ambienti di produzione in sala pulita sensibili.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Incisione di Wafer di Silicio	Movimentazione dei wafer durante la rimozione di strati sacrificali utilizzando chimiche a base di HF.	La completa resistenza all'attacco acido garantisce la longevità del porta wafer.
Processo di Pulizia RCA	Supporto dei wafer attraverso più fasi di rimozione di contaminanti organici e ionici.	La purezza del materiale previene la ricontaminazione delle superfici pulite.
Pulizia Post-CMP	Trasporto dei wafer attraverso spazzole di pulizia e bagni chimici dopo la planarizzazione.	Il basso rilascio di particelle mantiene conteggi di difetti estremamente bassi.
Rimozione del Fotoresist	Utilizzo di solventi aggressivi per rimuovere rivestimenti fotosensibili dopo la litografia.	L'inerzia chimica previene il degrado del materiale nei bagni di solvente.
Fabbricazione di Celle Solari	Supporto della lavorazione di substrati su larga scala in ambienti ad alta acidità per celle fotovoltaiche.	La durata nella produzione ad alto volume riduce i costi di sostituzione.
Produzione di MEMS	Gestione di delicati sistemi micro-elettromeccanici durante complesse fasi di rilascio a umido.	L'allineamento preciso degli slot previene danni meccanici alle strutture.
Campionamento Analitico	Utilizzo del porta wafer come supporto per substrati per analisi di metalli traccia ad alta purezza.	Livelli di fondo ultra-bassi garantiscono risultati di laboratorio accurati.

Categoria Caratteristica	Dettagli Tecnici per PL-CP82
Identificazione Prodotto	Porta Wafer Personalizzato Serie PL-CP82
Materiale Primario	PTFE Vergine ad Alta Purezza (Politetrafluoroetilene)
Compatibilità Dimensione Wafer	Standard 8 pollici (200mm) / Diametri completamente personalizzabili
Tipo di Configurazione	Disponibile a wafer singolo (individuale) o multi-slot
Metodo di Fabbricazione	100% Lavorazione CNC di Precisione (Nessun residuo di stampaggio)
Intervallo di Temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Compatibilità Chimica	Universale (HF, HCl, H2SO4, KOH, Acetone, ecc.)
Rugosità Superficiale	Personalizzabile in base a specifici requisiti di sala pulita
Passo / Profondità Slot	Adattato ai parametri di processo specifici del cliente

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Categoria Caratteristica	Dettagli Tecnici per PL-CP82	
Maniglia/Interfaccia	Punti di presa robotici personalizzati o opzioni di presa manuale	
Accuratezza Dimensionale	Controllo di tolleranza ad alta precisione secondo standard industriali	